

当会会員の(株)菅製作所(北斗市)が

平成29年1月24日付の日刊工業新聞に紹介されました。

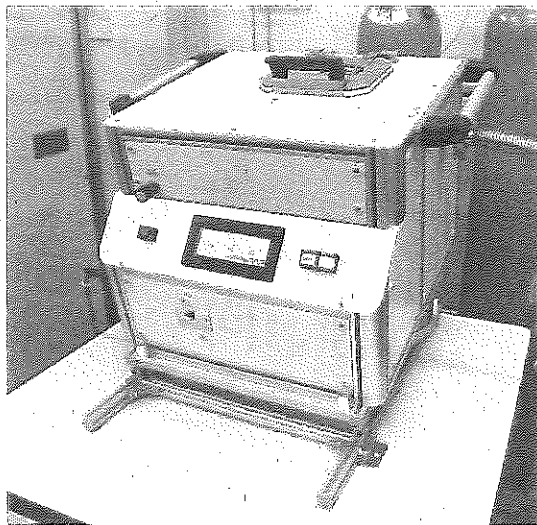
菅製作所

卓上型ALD装置

菅製作所(北海道北斗市、菅正社長、050・3734・0730)は、主に大学や研究機関向けスパッタ装置や真空装置などの研究開発支援機器に力を入れる。粉体に成膜加工できる装置などを卓上型原子層堆積(ALD)装置「SAL1000シリーズ」として、2016年12月に発売した。

ALD装置は半導体用シリコンウエハーなどの成膜に使われる。11年に

フロン
設計 | FRONTIER | 開発
ティア



粉体成膜モデル「SAL1000B」

差などにも対応して成膜できる技術だ。同社が特に力を入れる粉体成膜ができるモデルでは、真空内で均等に成膜できるように回転や振動などの機構を採用した。同社の実験では、粒径40nm(マイクロは100万分の1)のニッケル粉末に酸化アルミニウムを成膜することに成功している。

同シリーズは3種類を、価格を抑えつつ、卓上用意。卓上型の「SAL1000」が消費税抜き1000万円で、粉体の価格は650万円、粉体成膜の「SAL1000B」が同750万円、ALD法は精密な堆積酸化しやすい試料向け制御を実現し、均一に段

工藤主任は「価格の安い粉体でも機能性のあるものを成膜できるので、素材の付加価値を高めることができる」と強みをアピール。半導体素材メーカーや光学レンズメーカーなどにも提案を進める考えだ。

16年9月から同社の英語版サイト「AGUS」で「SSP1000キュービックスパッタ装置」の紹介を始めるなど、海外展開の強化も見据える。国内外の需要に対応し、新たな価値を提供する製品開発を続ける。

(札幌・山岸渉)

粉体成膜 真空内で均等に